

1日目 2026年9月2日（水）										
1 日 目	会場名	会場A	会場B	会場C	会場D	会場E	会場F	受付	企業ブース	懇親会
	会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室（4 F）	4Fホワイエ	3Fホワイエ	朱鷺メッセ
	収容人数	84	84	84	84	63	230（シアターで548）	—	—	—
	10：00～13：00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 日 目 （水）	13：00～17：30	13:00～17：30 技術／英語 セミナー	—	—	—	—	—	受付 （セッティング）	企業ブース （セッティング）	—
	18：00～19：00	—	—	—	—	—	—	受付	—	18：00～ ウェルカム レセプション

2日目 2026年9月3日(木)										
会場名	会場A	会場B	会場C	会場D	会場E	会場F	受付	企業ブース	懇親会	
会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室(4F)	4Fホワイエ	3Fホワイエ	朱鷺メッセ	
収容人数	84	84	84	84	63	230(ｼﾞｬｯｸで548)	—	—	—	
2 日 目 9 月 3 日 (木)	8:45～10:15	3-A-a1 誘電・絶縁材料 Ⅰ(5)	3-B-a1 【企画セッションⅠ】 ポストコロナ社会を支える先端 ナノ材料と有機デバイス技術の 最前線 —本分野の発展に貢献してきた 研究者の業績の継承と発展—	3-C-a1 教育・研究 (4)	3-D-a1 磁性材料・磁気応用・マ イクロ磁気Ⅰ(4)	3-E-a1 計測Ⅰ (5)	受付	9:00～ 企業ブース (展示)	—	
	10:30～12:00	—	—	—	—	—		企業ブース (展示)	—	
	昼休み	ランチョンセミナー	ランチョンセミナー	会場セッティング (一部の机撤去)	—	—		企業ブース (展示)	—	
	13:00～14:30	3-A-p1 誘電・絶縁材料 Ⅱ(5)	—	3-C-p1 13:30～17:20 【特別ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ】 革新的パワーエレ クトロニクスの研 究開発最前線	3-D-p1 磁性材料・磁気応用・マ イクロ磁気Ⅱ(5)	3-E-p1 計測Ⅱ (4)		企業ブース (展示)	—	
	14:45～16:15	3-A-p2 誘電・絶縁材料 Ⅲ(6)	3-B-p1 【企画セッションⅡ】 電力機器・設備の絶 縁劣化・異常診断技 術および評価技術の 最新動向		3-D-p2 電磁界理論, 電磁環境 (5)	3-E-p2 プラズマ (6)		～16:30 企業ブース (展示)	—	
	16:30～18:00	—	—		3-D-p3 【企画セッションⅢ】 魅力的なプレゼン資料の 作成法	—		—	—	

[illegible]

4日目 2026年9月5日（土）										
4 日 目 9 月 5 日 （ 土 ）	会場名	会場A	会場B	会場C	会場D	会場E	会場F	受付	企業ブース	懇親会
	会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室（4F）	4Fホワイエ	3Fホワイエ	朱鷺メッセ
	収容人数	84	84	84	84	63	230（シアターで548）	—	—	—
	8：45～10：15	5-A-a1 誘電・絶縁材料 VI(6)	子供 電気教室	5-C-a1 【企画セッションVI】 Society5.0に資する 高周波マイクロ磁気 デバイスの研究およ び実用化動向	5-D-a1 【企画セッションVII】 電気絶縁材料開発 におけるインフォ マティクス応用	—	—	受付	9：00～ 企業ブース （展示）	—
	10：30～12：00	5-A-a2 誘電・絶縁材料 VII（6）	子供 電気教室			—	—		～12：00 企業ブース （展示）	—
	昼休み	—	—	—	—	—	—	—	12：00～ 企業ブース （撤収）	—
	13：00～14：30	—	—	—	—	—	—	—	～14：00 企業ブース（撤収） 15:00 発送	—